

会 社 名 株式会社サムコインターナショナル研究所

コー ド 番 号 6387

(U R L <http://www.samco.co.jp>)

本 社 所 在 地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長

氏 名 山田史郎

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 3 月 25 日

中間配当支払日 平成 - 年 - 月 - 日

登録銘柄 (店頭登録銘柄)

本社所在都道府県 京都府

T E L (075) 621 - 7841

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 15 年 1 月中間期の業績(平成 14 年 8 月 1 日～平成 15 年 1 月 31 日)

(1) 経営成績

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15 年 1 月中間期	1,667 (9.3)	200 (46.5)	185 (49.6)
14 年 1 月中間期	1,839 (4.2)	374 (17.7)	368 (18.2)
14 年 7 月期	2,966	414	433

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 錢	円 錢
15 年 1 月中間期	103 (46.1)	21 10	
14 年 1 月中間期	191 (24.9)	39 14	
14 年 7 月期	242	49 54	

(注) 1. 持分法投資損益 15 年 1 月中間期 百万円 14 年 1 月中間期 百万円 14 年 7 月期 百万円

2. 期中平均株式数 15 年 1 月中間期 4,889,140 株 14 年 1 月中間期 4,889,680 株 14 年 7 月期 4,889,680 株

3. 会計処理の方法の変更 無

4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 錢	円 錢
15 年 1 月中間期	0 00	
14 年 1 月中間期	0 00	
14 年 7 月期		12 50

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 錢
15 年 1 月中間期	7,264	4,628	63.7	946 68
14 年 1 月中間期	7,126	4,541	63.7	928 88
14 年 7 月期	7,053	4,592	65.1	939 29

(注) 1. 期末発行済株式数 15 年 1 月中間期 4,889,140 株 14 年 1 月中間期 4,889,140 株 14 年 7 月期 4,889,140 株

2. 期末自己株式数 15 年 1 月中間期 1,750 株 14 年 1 月中間期 1,750 株 14 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
15 年 1 月中間期	40	129	135	1,314
14 年 1 月中間期	150	128	457	1,243
14 年 7 月期	386	30	446	1,620

2. 15 年 7 月期の業績予想(平成 14 年 8 月 1 日～平成 15 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当たり 年間 配 当 金		
				中 間	期 末	円 錢
通 期	百万円 3,700	百万円 560	百万円 310	円 錢 12 50	円 錢 12 50	円 錢 12 50

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 62 円 12 錢

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 6 ページを参照してください。

添付書類

1. 企業集団の状況

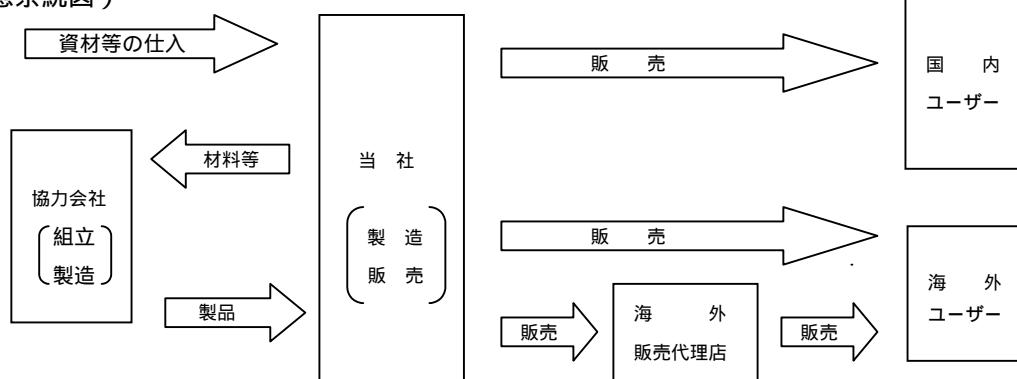
当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はプラズマを利用したCVD法(Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法)によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm ~ 100 μmまでの成膜や加工が可能であります。(nm = ナノメートル : 10億分の1メートル μm = マイクロメートル : 1百万分の1メートル)

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッティング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。

(業態系統図)



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

(CVD装置)

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置 (LS = Liquid Source) に特徴があり、比較的低温反応で速度が速く、均一性の良い成膜が可能であります。

(エッティング装置)

各種半導体の基板上の膜をはじめ微細加工が必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて切削していくものです。当社はICP (Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ) を利用したエッティングに特徴があり、高速かつ均一性の優れた加工が可能であります。

(洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

(その他装置)

上記装置には含まれない特別な装置であります。

(その他)

部品、保守メンテナンスなどであります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、

社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。

直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。

事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、1単元株式数の見直し等株式投資単位の引き下げにつきましては、引き続き業績、市況等を勘案しつつ慎重に検討し、対処していく所存であります。

(4) 中期的な会社の経営戦略

当社は自動車用途、白色照明用途や信号機用途向けに開発が盛んな高輝度 LED (Light Emitting Diode = 発光ダイオード) や主に次世代大容量光ディスク用途向けの LD (Laser Diode=半導体レーザー) を中心とするオプトエレクトロニクス分野に引き続き注力してまいります。今後、この市場は各デバイスの量産から製品化への流れが活発であるため、この分野の研究開発をリードしてきた当社としましても、当面は市場の動きに合わせた量産用装置に重点を置きながら、業容の拡大を図りたいと考えております。

また、様々なセンサーヤチップが開発されている電子部品分野に、一層の省力化、高付加価値化に繋がるエッキング装置の開発に力を入れるとともに、有機 EL (Electro Luminescence) やプラズマディスプレイ等の FPD (Flat Panel Display) 分野に対する洗浄装置の販売強化も同時に図ってまいります。

(5) 対処すべき課題

現状の認識について

現況では、LED、LD が牽引役となるオプトエレクトロニクス市場が堅調なもの、他の分野の動きも活発であり、的確にその状況を把握していく必要があると考えております。すなわち、オプトエレクトロニクス分野での通信部門の回復時期、シリコン市場での国内メーカーの事業再編の動向、電子部品分野の高性能化への方向性に注目が集まり、また新エネルギー関連分野での新たな利用形態方法等が開発されている中、それぞれの分野の成長時期を目利きしていくことが重要と考えます。

当面の対処すべき課題の内容

当面はオプトエレクトロニクス分野の LED、LD 用途向けの、量産用装置の本格的開発と一層の販売力強化が重点的課題であります。さらに一層の業容拡大のために、他分野に対する積極的な対応や適材適所の人材を確保する必要もあると考えております。

対処方針

量産用装置の本格的開発と販売力強化は既に計画実行中であり、スケジュール通り進捗させていくことが重要であります。また他の分野に対する積極的な対応については、産官学連携の強化や海外も含めた各種展示会の活用並びに適切な業務提携等を積極的に推進していくとともに、適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化することにより対応していく方針であります。

具体的な取組状況等

産官学連携の強化については、京都ナノテククラスターを含めた各大学との共同研究の継続をし、展示会については今年初めてセミコンチャイナにも出展しております。また業務提携については先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していくとともに、人材確保に対しては上半期から中途採用を積極化しており、下半期にも設計部門と管理部門の強化の為の補強を計画しております。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当中間期の概況

当中間期のわが国経済は、個人消費や民間設備投資に力強さが見られず、さらにデフレ対策遅延等により株式市場の低迷が続いており、長期的な景気停滞感から未だに脱しきれない状況で推移いたしました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、設備投資と研究開発が巨額にのぼることによる事業リスクの拡大懸念から、昨年頃より始まった半導体メーカーの世界的な事業の再編や統合の流れの中にはあって、国内の半導体メーカー各社は技術の選択と集中を迫られ、総じて設備投資が抑制された時期がありました。その中にあっては、デジタル家電関連を中心とした電子部品分野の設備投資が比較的堅調に推移し、また自動車関連や次世代大容量ディスク用途向けの青色 LED や青色 LD を中心としたオプトエレクトロニクス分野の光源部門も概ね活発に推移いたしました。

こうした環境の中、当社は、オプトエレクトロニクス分野の光源部門において、従来から培った豊富な基礎技術やプロセス技術の蓄積とエッティング装置を中心とした営業推進が功を奏し、着実に販売実績を伸ばすことができました。また電子部品市場に競争力のある独創的な新製品を投入するなど、特色を活かした研究開発活動を推進するとともに、前期に引き続き、仕入原価や製造原価などのコスト低減に鋭意努力いたしました。

以上のような活動をしてまいりましたものの、当中間期は、期首の受注残(897百万円)が前年同期期首の受注残(1,247百万円)と比較して約350百万円少なかったことや、コスト低減に努力したものとの特定機種においては、競争激化に伴う販売単価の下落が見られたことなどの理由により、売上高は1,667,826千円(前年同期比9.3%減)、経常利益は185,857千円(前年同期比49.6%減)、中間純利益は103,149千円(前年同期比46.1%減)の結果となりました。

(CVD装置)

オプトエレクトロニクス分野を中心とした研究開発用途向けに出荷できたに留まり、光導波路用成膜装置として量産用途向けの出荷が売上高に貢献していた前期と比較して大幅な減少となりました。

当社の得意とするLS-CVD装置は封止膜等パッシベーションや光導波路等の厚膜の成膜に適していることから、有機EL等、FPD分野の封止膜用途での量産化や光通信分野の回復を期待するものの、両者とも今期中の売上高に対する貢献は少ないと考えており、しばらくは苦戦が続くと思われます。上半期の売上高は261百万円(前年同期比68.1%減)と大幅な減少になりました。

(エッティング装置)

当社が注力しているエッティング装置のうち、特にICP型のRIE-200iPの需要は、半導体メーカーにおける青色LEDの量産化が顕著になり始めた前期下半期から増加し、本期に入り、一段とその傾向が強くなりました。LEDの製法に不可欠なGaN(窒化ガリウム)のエッティングに、当社の装置が最適との支持を受けたものと認識しております。また小型機種ながら使い勝手が良いRIE-10NRも特に研究開発用として根強い人気を受けた結果、上半期の売上高は1,105百万円(前年同期比60.6%増)と大幅に増加しました。

(洗浄装置)

昨年前半頃から広がり始めたシリコン市場の回復感から、当社も前期の下半期の好調さが持続する計画したものの、やや一時的な現象に終わり、結果としてみれば前年同期とほぼ同様となり、上半期の売上高は121百万円(前年同期比3.7%減)となりました。

(その他装置)

エッティング装置に付帯する装置で、プロセスガス供給系並びに排ガス用の特殊緊急除外装置の出荷があり、その結果上半期の売上高は30百万円(前年同期比37.8%減)となりました。

(その他)

部品やメンテナンスが出荷台数の増加に伴い比較的安定的に推移しました。その結果上半期の売上高は149百万円(前年同期比5.6%減)となりました。

(品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
CVD装置	261,550	15.7	68.1
エッチング装置	1,105,225	66.3	60.6
洗浄装置	121,599	7.3	3.7
その他の装置	30,000	1.8	37.8
その他	149,452	8.9	5.6
合 計	1,667,826	100.0	9.3

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、 LED・LD・DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex = 高密度波長多重伝送) 関連のオプトエレクトロニクス分野 各種センサー・磁気ヘッド・水晶デバイス・高周波デバイスなどの電子部品分野、 有機ELなど の表示デバイス分野、 半導体パッケージ技術や混載技術などの実装・表面処理分野、 その他分野、 部品・メンテナンスに分類しており、 その売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	835,182	50.1	14.5
電子部品分野	396,681	23.8	9.6
表示デバイス分野	95,445	5.7	94.9
実装・表面処理分野	53,910	3.3	14.2
その他の分野	137,156	8.2	10.8
部品・メンテナンス	149,452	8.9	5.6
合 計	1,667,826	100.0	9.3

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税引前中間純利益が 184,398 千円（前年同期比 48.8% 減）となったものの、売上債権の増加額 488,320 千円、有形固定資産の取得による支出額 107,661 千円、長期借入金の返済による支出額 74,500 千円などのマイナス要因があつたため、資金残高は前事業年度末に比べ 306,330 千円減少となり、当中間会計期間末には 1,314,069 千円（前年同期比 5.7% 増）となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 40,525 千円（前年同期比 73.1% 減）となりました。これは主に税引前中間純利益 184,398 千円（前年同期比 48.8% 減）仕入債務の増加額 280,127 千円がプラスに寄与したもの、売上債権の増加額 488,320 千円などがマイナスに作用したものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 129,061 千円（前年同期は得られた資金 128,617 千円）となりました。その主な内容は定期預金の払戻による収入 927,067 千円に対して、定期預金の預入による支出が 949,962 千円であったことと有形固定資産の取得による支出が 107,661 千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は 135,614 千円（前年同期比 70.3% 減）となりました。これは、主に長期借入金の返済額 74,500 千円、配当金の支払額 61,114 千円があったことによるものです。

(3) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、青色 LED 等の材料として使われる GaN の加工用のエッチャリング装置を中心に、前期に比べ堅調な需要が見込まれること、またガラス、セラミック、金属系の電子基板材料に対応する新製品の「RIE - 2000SQ」をはじめ当社装置が電子部品分野のエッチャリング装置として支持されていること、さらには当社のマザーマーケットである産官学のナノテク関連の研究開発分野においても、政府の積極的な予算配分や研究開発推進税制の制定が追い風となって堅調に推移するものと見込んでおります。一方、携帯電話や液晶パネルに利用される有機 EL など、FPD 分野に対する封止膜形成用の CVD 装置等は、今後の成長分野であるものの、今期の売上高への寄与は低いと予想しております。

以上の見通しにより、通期の売上高は 3,700 百万円(前年同期比 24.7% 増) 経常利益は 560 百万円(前年同期比 29.2% 増) 当期純利益は 310 百万円(前年同期比 28.0% 増)となる見込みであります。